

## American Vacuum Society 59th International Symposium & Exhibition での海外論文発表



目で見る  
宮原国際研究活動  
助成論文発表

溝谷浩平\*

Presentation at American Vacuum Society  
59th International Symposium & Exhibition in Tampa

Key Words : finFET, Plasma Etching, Molecular Dynamics Simulation

- <参加会議> American Vacuum Society 59th International Symposium & Exhibition
- <開催場所> Tampa, Florida, USA
- <渡航期間> October 28 – November 2, 2012
- <発表タイトル> Molecular Dynamics Simulation of Possible Damage Formation at Vertical Walls of fin-FET Devices during Plasma Etching Processes.

米国フロリダ州のタンパで開催された米国真空学会主催の国際シンポジウムに参加してきました。本学会はナノ科学、プラズマ科学、薄膜技術といった新規技術の工業応用に関する議論を積極的に行っており、私はその中のプラズマセッションで口頭発表を行いました。内容は半導体デバイスの更なる微細化を実現するためプラズマによる半導体表面加工時のダメージを数値解析するというもので、報告後に、ダメージの形成機構について質問を受けたのに加えて、翌日以降もシミュレーションを実現するための分子間ポテンシャルの詳細について訊かれるなど本研究について活発な議論を行う事ができ、大変貴重な機会になりました。今後も機会があれば積極的に海外学会に参加したいと思っています。



写真1 発表風景



写真2 Plasma Science and Technology セッション



\*Kohei MIZOTANI

1983年7月生  
大阪大学大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 博士前期課程卒業 (2012年)  
現在、大阪大学大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 エネルギー形態制御分野(浜口研究室) 博士後期課程1年  
TEL : 090-3728-5392  
FAX : 06-6879-7917  
E-mail : mizotani@ppl.eng.osaka-u.ac.jp



写真3 懇親会会場